

(19) 世界知的所有権機関  
国際事務局(43) 国際公開日  
2005 年 8 月 4 日 (04.08.2005)

PCT

(10) 国際公開番号  
WO 2005/070692 A1(51) 国際特許分類:  
B41C 1/05, G03F 7/20, 7/24

B41N 1/12,

(74) 代理人: 浅村 皓, 外(ASAMURA, Kiyoshi et al.); 〒1000004 東京都千代田区大手町 2 丁目 2 番 1 号 新大手町ビル 3 3 1 Tokyo (JP).

(21) 国際出願番号: PCT/JP2005/000954

(22) 国際出願日: 2005 年 1 月 26 日 (26.01.2005)

(25) 国際出願の言語: 日本語

(26) 国際公開の言語: 日本語

(30) 優先権データ:  
特願2004-018472 2004 年 1 月 27 日 (27.01.2004) JP

(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 旭化成ケミカルズ株式会社 (ASAHI KASEI CHEMICALS CORPORATION) [JP/JP]; 〒1008440 東京都千代田区有楽町一丁目 1 番 2 号 Tokyo (JP).

(72) 発明者: および

(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 山田 浩 (YAMADA, Hiroshi) [JP/JP]; 〒4110031 静岡県三島市幸原町 2-1 9-1 3 Shizuoka (JP). 留場 啓 (TOMEDA, Kei) [JP/JP]; 〒4160939 静岡県富士市川成島 6 9 0-1 クリエイトハイツ 1 0 3 Shizuoka (JP). 渡辺 巳吉 (WATANABE, Miyoshi) [JP/JP]; 〒4170851 静岡県富士市富士見台 6-1 1-2 2 Shizuoka (JP).

(81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GI, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

一 国際調査報告書

2 文字コード及び他の略語については、定期発行される各 PCT ガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

(54) Title: PROCESS FOR PRODUCING PRINTING SUBSTRATE CAPABLE OF LASER SCULPTURE

(54) 発明の名称: レーザー彫刻可能な印刷基材の製造方法

(57) Abstract: A process for producing a printing substrate capable of laser sculpture, comprising the step of forming a layer of photosensitive resin composition on a cylindrical support or sheeted support and the step of irradiating the formed layer of photosensitive resin composition with light to thereby provide a layer of cured photosensitive resin of 50  $\mu$ m to 50 mm thickness, wherein the light for irradiation of the photosensitive resin composition layer contains a ray of 200 to 450 nm wavelength and wherein the light illuminance on the surface of the photosensitive resin composition layer is in the range of 20 mW/cm<sup>2</sup> to 2 W/cm<sup>2</sup> when measured with the use of UV meter (trade name "UV-M02" manufactured by Ohku Seisakusho) and filter (trade name "UV-35-APR Filter" manufactured by Ohku Seisakusho) and in the range of 3 mW/cm<sup>2</sup> to 2 W/cm<sup>2</sup> when measured with the use of the above UV meter and filter (trade name "UV-25 Filter" manufactured by Ohku Seisakusho).(57) 要約: 【課題】円筒状支持体又はシート状支持体上に感光性樹脂組成物層を形成する工程、及び形成された感光性樹脂組成物層に光を照射し厚さ 50  $\mu$ m 以上 50 mm 以下の感光性樹脂硬化物層を形成する工程を含み、該感光性樹脂組成物層に照射する光が 200 nm 以上 450 nm 以下の波長の光を含み、かつ該感光性樹脂組成物層の表面での光の照度が、UV メーター（オーク製作所社製、商標「UV-M02」）とフィルター（オーク製作所社製、商標「UV-35-APR フィルター」）を用いて測定した場合、20 mW/cm<sup>2</sup> 以上 2 W/cm<sup>2</sup> 以下であり、かつ前記 UV メーターとフィルター（オーク製作所社製、商標「UV-25 フィルター」）を用いて測定した場合、3 mW/cm<sup>2</sup> 以上 2 W/cm<sup>2</sup> 以下である、レーザー彫刻可能な印刷基材の製造方法。

WO 2005/070692 A1